

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】令和 2 年 4 月 23 日 (2020.4.23)

【公開番号】特開 2018-176139 (P2018-176139A)

【公開日】平成 30 年 11 月 15 日 (2018.11.15)

【年通号数】公開・登録公報 2018-044

【出願番号】特願 2017-84282 (P2017-84282)

【国際特許分類】

B 0 9 B 3/00 (2006.01)

B 0 1 D 53/38 (2006.01)

B 0 1 D 53/58 (2006.01)

B 0 1 D 53/75 (2006.01)

B 0 1 D 53/78 (2006.01)

【 F I 】

B 0 9 B 3/00 3 0 2 F

B 0 1 D 53/38 1 5 0

B 0 1 D 53/58 Z A B

B 0 1 D 53/75

B 0 1 D 53/78

B 0 1 D 53/38 1 2 0

【手続補正書】

【提出日】令和 2 年 3 月 10 日 (2020.3.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 5 5 】

水槽 3 1 の内部で水面の上方には、仕切板 3 6 が設けられている。洗浄装置 3 0 に供給されたガスは、仕切板 3 6 と水面との間を流れてスクラバー室 3 7 に供給される。ガスが仕切板 3 6 と水面との間を流れることにより、ガスを水 W と接触させることができ、ガスに含まれるアンモニア等の水溶性の成分を水 W に吸収させて取り除くことができる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 6】

